



#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 09199854 A

(43) Date of publication of application: 31.07.97

(51) Int. CI

H05K 3/46

(21) Application number: 08009005

(22) Date of filing: 23.01.96

(71) Applicant:

**NEC CORP** 

(72) Inventor:

YOSHIKAWA TAKEO

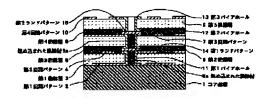
### (54) MULTILAYER INTERCONNECTION BOARD AND MANUFACTURE THEREOF

#### (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To contrive the reliable connection and easy connection of via holes and the enhancement of the yield of the formation of the via holes and the like.

SOLUTION: This hoard is constituted into a structure, wherein circuit patterns and insulating layers are laminated in order on the surface of a core board and at the same time, the circuit patterns holding each insulating layer between them are connected with each other through each via hole. In this case, the board is formed into a structure, wherein the first via hole 11 to the third via hole 13 are formed into the shape of a straight line in the laminating direction and each cap-shaped land pattern 14 or 15 is made to interpose between the via holes to connect the via holes 11 and 13 with each other.

COPYRIGHT: (C)1997,JPO



(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平9-199854

(43)公開日 平成9年(1997)7月31日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup> H 0 5 K 3/46 識別記号 庁内整理番号

FI H05K 3/46 技術表示箇所

N E

T

審査請求 有 請求項の数4 OL (全 5 頁)

(21)出願番号

(22)出顧日

特顯平8-9005

平成8年(1996)1月23日

(71)出願人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72)発明者 吉川 武夫

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

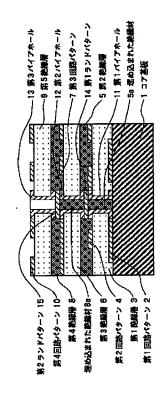
(74)代理人 弁理士 若林 忠

## (54) 【発明の名称】 多層配線基板、および多層配線基板の製造方法

## (57)【要約】

【課題】 バイアホールの接続信頼性、接続容易性、バイアホールの形成歩留りの向上等を図るために、従来のビルドアップ基板では層間で隣接するバイアホールは互いにずらして形成する必要があった。そのため、基板を平面的に見るとバイアホールの占有率が増すため、基板の配線密度、配線収容性を高めることが難しかった。

【解決手段】 コア基板の表面に回路パターンと絶縁層を順次積層すると共に、各絶縁層を挟む回路パターン間をバイアホールで接続した構造の多層配線基板において、第1乃至第3バイアホール11~13を積層方向に一直線状に形成し、各バイアホール間に蓋状のランドパターン14又は15を介在させて第1乃至第3バイアホール11~13を接続した構造である。



10

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 有機系材料からなるコア基板の片面あるいは両面に回路パターンと絶縁層を順次積層すると共に、各絶縁層を挟む回路パターン間をバイアホールで接続した構造の多層配線基板において、

前記各バイアホールを積層方向に一直線状に形成し、前 記各バイアホール間に蓋状のランドパターンを介在させ て前記各バイアホールを接続した構造であることを特徴 とする多層配線基板。

【請求項2】 有機系材料からなるコア基板の片面あるいは両面に回路パターンと絶縁層を順次積層すると共に、各絶縁層を挟む回路パターン間をバイアホールで接続した構造の多層配線基板の製造方法において、

第1バイアホールが形成された第1絶縁層の表面に感光 性有機樹脂を塗布して、当該樹脂を前記第1バイアホー ルに埋め込んだ後、前記樹脂を硬化させて第2絶縁層を 形成する第1工程と、

前記第2 絶縁層の、前記第1 バイアホールの直上部分を、前記第1 バイアホールに埋め込まれた樹脂を除き、 光露光とエッチングにより除去する第2 工程と、

前記第1バイアホール直上に蓋状の第1ランドパターン をメッキによって形成する第3工程と、

前記第1ランドパターンを含む前記第2絶縁層上に感光性有機樹脂を塗布した後、当該樹脂を硬化させて第3絶縁層を形成する第4工程と、

前記第3絶縁層の、前記第1ランドパターンの直上部分を光露光とエッチングにより除去した後、前記第1ランドパターン直上に第2バイアホールをメッキによって形成する第5工程と、

を含むことを特徴とする多層配線基板の製造方法。

【請求項3】 前記第1絶縁層の表面に塗布する感光性 有機樹脂の厚みは回路パターンのメッキ厚に比べて大き いことを特徴とする請求項2に記載の多層配線基板の製 造方法。

【請求項4】 前記第1乃至第5工程を繰り返して多層 化すると共に、前記各バイアホールを積層方向に一直線 状に形成することを特徴とする請求項2に記載の多層配 線基板の製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、有機系材料からなるプリント配線基板に関し、特にビルトアップ工法によって形成される多層プリント配線基板及びこの製造方法に関する。

#### [0002]

【従来の技術】従来の多層プリント配線基板としては、 例えば図4に示すものがある。図4は、従来の多層プリント配線基板の一構造例を示す断面図である。

【0003】図4に示す多層プリント配線基板はビルド アップ工法で製造されるもので、有機系材料からなるコ 2

ア基板111を備える。このコア基板111上には、第 1回路パターン112、第1絶縁層113、第2回路パ ターン114、第2絶縁層115、第3回路パターン1 16、第3絶縁層117、第4回路パターン118が順 次積層されている。コア基板111上の第1回路パター ン112と第2回路パターン114とは、第1絶縁層1 13に形成された第1バイアホール (Via Hole) 119 を介して接続され、第2回路パターン114と第3回路 パターン116とは、第2絶縁層115に形成された第 2バイアホール120を介して接続され、第3回路パタ ーン116と第4回路パターン118とは、第3絶縁層 117に形成された第3バイアホール121を介して接 続されている。なお、第1乃至第3絶縁層は同一の感光 性有機樹脂材料からなる。第1乃至第3バイアホールは 感光性有機樹脂材料を光露光技術と選択エッチングによ って開口し、開口穴部分をメッキ処理してなる。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】上記の従来の多層配線 基板ではビルドアップ工法において全層のバイアホール を縦積みに形成することも可能である。しかし、図4に 示したように3層以上にわたってバイアホールを形成す る場合、層間で隣接するバイアホールの接続信頼性、接 続容易性、バイアホールの形成歩留りの向上等を図るた めに、層間で隣接するバイアホールは互いにバイアホー ルのランド径以上にずらして形成する必要があった。

【0005】そのため、基板を平面的に見るとバイアホールの占有率が増すため、基板の配線密度、配線収容性を高めることが難しくなるという問題点が生じる。

【0006】本発明の目的は、上記従来技術の問題点に鑑み、各層のバイアホールを積層方向に一直線に形成してもバイアホールの接続信頼性、接続容易性、バイアホールの形成歩留りの向上を図ることができ、その結果、基板の配線密度、配線収容性(パターン収容密度)も向上する多層配線基板、及び多層配線基板の製造方法を提供することにある。

#### [0007]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に本発明は、有機系材料からなるコア基板の片面あるい は両面に回路パターンと絶縁層を順次積層すると共に、

40 各絶縁層を挟む回路パターン間をバイアホールで接続した構造の多層配線基板において、前記各バイアホールを 積層方向に一直線状に形成し、前記各バイアホール間に 蓋状のランドパターンを介在させて前記各バイアホール を接続した構造であることを特徴とする。

【0008】また、上記構造の多層配線基板の製造方法において、第1バイアホールが形成された第1 絶縁層の表面に感光性有機樹脂を塗布して、当該樹脂を前記第1バイアホールに埋め込んだ後、前記樹脂を硬化させて第2 絶縁層を形成する第1工程と、前記第2 絶縁層の、前50 記第1バイアホールの直上部分を、前記第1バイアホー

10

30

40

ルに埋め込まれた樹脂を除き、光露光とエッチングによ り除去する第2工程と、前記第1バイアホール直上に蓋 状の第1ランドパターンをメッキによって形成する第3 工程と、前記第1ランドパターンを含む前記第2絶縁層 上に感光性有機樹脂を塗布した後、当該樹脂を硬化させ て第3絶縁層を形成する第4工程と、前記第3絶縁層 の、前記第1ランドパターンの直上部分を光露光とエッ チングにより除去した後、前記第1ランドパターン直上 に第2バイアホールをメッキによって形成する第5工程 と、を含むことを特徴とする。

【0009】この製造方法においては、前記第1絶縁層 の表面に塗布する感光性有機樹脂の厚みは回路パターン のメッキ厚に比べて大きいことが好ましい。

【0010】さらに、前記第1乃至第5工程を繰り返す ることで多層化すると共に、前記各バイアホールを積層 方向に一直線状に形成することが可能である。

【0011】上記のとおりの発明では、バイアホール直 上に蓋状のランドパターンを形成したことにより、バイ アホールの接続信頼性、接続容易性、バイアホールの形 成歩留りの向上等が保証され、次層のバイアホールを積 層方向に一直線状に接続させていくことが可能となる。 また、バイアホールが積層方向に一直線状に接続可能と なることで、基板の配線密度、配線収容性(パターン収 容密度)も向上する。

#### [0012]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい て図面を参照して説明する。

【0013】図1および図2は本発明の多層配線基板の 製造方法の一実施形態を説明するための断面図であり、 図1 (a) ~ (c) 、そして図2 (d) ~ (f) の順序 で製造工程を示してある。この図1と図2は製造工程を 明瞭に示すために便宜上分けたものである。

【0014】まず図1(a)に示すように、有機材料か らなるコア基板1の表面に第1回路パターン2を形成す る。次いで、絶縁性で液状の感光性有機樹脂をコア基板 1上に塗布した後ベーキングを行い、第1絶縁層3を形 成する。さらに、光露光とエッチングにより第1絶縁層 3の所定の箇所を開口し、その開口穴の内壁に無電解メ ッキを施すことにより第1バイアホール11を形成す る。また同時に第1絶縁層3上に第2回路パターン5も 形成する。

【0015】次に図1(b)に示すように、第1絶縁層 3上に再び絶縁性で液状の感光性有機樹脂を塗布した後 ベーキングを行い、第2絶縁層5を形成する。この時の 樹脂厚は通常、回路パターンのメッキ厚に比べて大き い。これはバイアホールへの十分な埋込みと、回路パタ ーン間に十分な埋め込むを行う為である。また、この時 の第2絶縁層5を形成する樹脂は第1絶縁層3を形成し た樹脂と同じ特性のものであっても良いし、誘電率、粘 性等の特性が若干違っても問題はない。

【0016】そして図1(c)に示すように、第1バイ アホール11直上の第2絶縁層5を光露光とエッチング によって除去し、開口部5bを形成する。このとき、バ イアホールに埋め込まれた絶縁材5aは除去しないよう に、十分なコントロールが必要である。

【0017】次に図2(d)に示すように、開口部5b の底部上(第1バイアホール11直上)に第1ランドパ ターン14をメッキによって形成する。これは、いわば マンホールの蓋状のものであり、他のバイアホールとの 接触面積を増やして接続歩留りを向上させるものであ る。

【0018】そして図2(e)に示すように、第2絶縁 層 5 上に絶縁性で液状の感光性有機樹脂を塗布した後べ ーキングを行い、第3絶縁層6を形成する。この第3絶 縁層6を形成する樹脂は第1絶縁層3を形成する樹脂と 同一である。

【0019】次に図2(f)に示すように、前記の第1 バイアホールの形成と同様に、第1ランドパターン14 直上の第3絶縁層6を光露光とエッチングによって開口 し、その後、第2バイアホール12を形成する。

【0020】以上が2つの絶縁層間にわたって2つのバ イアホールを一直線状に形成する工程である。以上の工 程を繰返すことにより、3つの絶縁層間にまたがる3つ のバイアホールを持つ多層配線基板が完成する。

【0021】図3は図1及び図2に示した工程を繰り返 し、コア基板の片面に3回絶縁膜と回路パターンを積層 した構造の多層配線基板の断面図を示す。

【0022】本形態の多層配線基板はビルドアップ工法 により製造されるもので、図3に示すように、有機系材 料からなるコア基板1を備える。このコア基板1は絶縁 基板、あるいは両面又は多層のリジッド板であればよ く、必要に応じ選択されている。

【0023】コア基板1上には、第1回路パターン2、 第1絶縁層3、第2回路パターン4、第2絶縁層5、第 3絶縁層6、第3回路パターン7、第4絶縁層8、第5 絶縁層9、第4回路パターン10が順次積層されてい

【0024】コア基板1上の第1回路パターン2と第2 回路パターン4とは、第1絶縁層3に形成され絶縁材5 a が埋め込まれた第1バイアホール (Via Hole) 11を 介して接続されている。第2回路パターン4と第3回路 パターン7とは、第1バイアホール11上の第1ランド パターン14および、第3絶縁層6に形成され絶縁材8 a が埋め込まれた第2バイアホール12を介して接続さ れている。第3回路パターン7と第4回路パターン10 とは、第2バイアホール12上の第2ランドパターン1 5および、第5絶縁層9に形成された第3バイアホール 13を介して接続されている。これら第1乃至第3バイ アホールは積層方向に一直線状になるように形成されて 50 いる。

\_

【0025】なお、本例ではコア基板の片面に積層した 多層配線基板を示したが、本発明はこれに限られず、コ ア基板の両面に積層されたものであっても良い。

#### [0026]

【発明の効果】以上説明した本発明は、各バイアホール間に蓋状のランドパターンを介在させることで、バイアホールを絶縁層間にわたって一直線状に形成できるため、基板の配線密度、配線収容性(パターン収容密度)が向上する効果がある。

【0027】また、バイアホールを光露光技術とエッチング技術、メッキ技術で形成するため、従来のドリルで 穴明けするスルーホールに比べてはるかに微細なバイアホールが形成できる効果がある。

【0028】さらに、バイアホールを一直線状に形成するため、そのバイアホールはスルーホールの役割を併せ持つ効果がある。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の多層配線基板の製造方法の一実施形態 を説明するための断面図である。

【図2】本発明の多層配線基板の製造方法の一実施形態 を説明するための断面図である。

【図3】図1及び図2に示した工程を繰り返し、コア基板の片面に3回絶縁層と回路パターンを積層した構造の \*

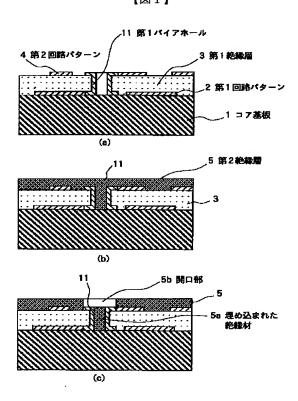
\* 多層配線基板の断面図を示す。

【図4】従来の多層プリント配線基板の一構造例を示す 断面図である。

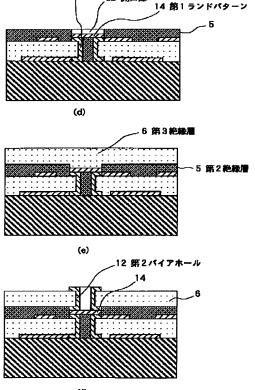
#### 【符号の説明】

- 1 コア基板
- 2 第1回路パターン
- 3 第1絶縁層
- 4 第2回路パターン
- 5 第2絶縁層
- 10 5 a 埋め込まれた絶縁材
  - 5 b 開口部
  - 6 第3絶縁層
  - 7 第3回路パターン
  - 8 第4絶縁層
  - 8 a 埋め込まれた絶縁材
  - 9 第5絶縁層
  - 10 第4回路パターン
  - 11 第1バイアホール
  - 12 第2バイアホール
- 20 13 第3バイアホール
  - 14 第1ランドパターン
  - 15 第2ランドパターン

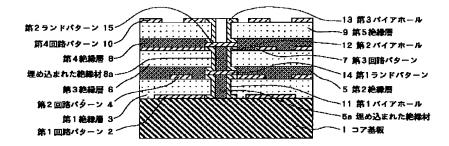
【図1】



【図2】



## 【図3】



## 【図4】

